

三、研发中的知识产权申请

(一) 知识产权类型

知识产权包括：商标、专利、著作权（版权）、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。研发是企业经营管理活动中知识产权产出最多的环节，在产品研发流程的各环节中都可能产生不同类型的知识产权。

1. 商标

商标是企业的商品与他人的商品区别开的标志。在我国，文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。注册商标自核准注册之日起有效期为10年，有效期满需要继续使用的，企业可以按照规定办理续展手续，每次续展注册的有效期为10年，自该商标上一届有效期满次日起计算。

2. 专利

在我国，专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。根据2020年新修正的《专利法》规定，发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；外观设计是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、

图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。我国发明专利权的期限为 20 年，实用新型专利权的期限为 10 年，外观设计专利权的期限为 15 年，均自申请日起计算。

3. 著作权

根据我国 2020 年新修正的《著作权法》规定，著作权的作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，包括：文字作品；口述作品；音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；美术、建筑作品；摄影作品；视听作品；工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；计算机软件；符合作品特征的其他智力成果。在我国，作者的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受限制；对于自然人的作品，著作权中的发表权和财产权利的保护期为作者终生及其死亡后 50 年，截止于作者死亡后第 50 年的 12 月 31 日；对于法人或者非法人组织的作品，著作权财产权利的保护期为 50 年，截止于作品首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，其发表权的保护期为 50 年，截止于作品完成或首次发表后第 50 年的 12 月 31 日。

4. 集成电路布图设计

集成电路布图设计是指集成电路中至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路的三维配置，或者为制造集成电路而准备的上述三维配置。在我国，布图设计专有权的保护期为 10 年，自申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算，以较前日期为准。

（二）知识产权类型的选择

企业可以根据自身实际情况、结合所在行业的现状，考虑将企业的研发成果选用具体的知识产权类型进行保护。

① 产品概念和新技术方案形成、对现有技术方案的优化和改良、ID 设计图呈现、产品功能和控制方法的实现，可以分别申请发明、实用新型、外观设计等不同的专利类型进行保护。

② 产品使用的型号、名称在经过设计后可以申请商标注册保护。

③ 在具体的硬件开发和软件开发环节，可以将集成电路布图设计、软件程序和代码通过登记获得集成电路布图设计专有权、计算机软件著作权保护。

④ 企业的包装、装潢设计可以通过著作权作品登记进行保护。

⑤ 企业独有的、不适合申请专利保护的技术实现方法、特殊工艺方法、材料组成和配方等，可以通过商业秘密进行保护。

四、产品及研发管理中的知识产权保护

（一）产品研发流程中的知识产权工作要点

通常而言，发展中企业和成熟企业的产品开发流程有概念、计划、开发、验证、发布、产品生命周期管理这几个阶段，而初创企业的产品开发流程相对简单灵活。综合来看，在产品研发的